

ТЕРМОЭДС ТЕЛЛУРИДА РТУТИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Городилов Н. А., Доманская Л. И., Нейфельд Э. А.,
Шелушинина Н. Г.

В образцах чистого теллурида ртути при $5 \leq T \leq 30$ К наблюдалась термоэдс увлечения электронов фононами в квантующих магнитных полях. Сделана оценка эффективной константы деформационного потенциала для зоны Γ_8 : $E_0 = 1 \div 2$ эВ.

Проведены измерения поперечной α_{xx} и продольной α_{zz} компонент термоэдс на чистых образцах HgTe при $5 \leq T \leq 30$ К в магнитных полях H до 45 кЭ. Параметры исследованных образцов представлены в таблице.

№ образца	$n \cdot 10^{-15}$, см $^{-3}$	s_F , мэВ	$\mu_n \cdot 10^{-5}$, см 2 /В·с
1	1.6	1.6	8.0
2	2.1	2.0	4.0

Образец 1 по своим параметрам относится к наиболее чистым образцам HgTe (см. [1, 2]). Анализ температурных зависимостей концентрации (n) и подвижности (μ_n) электронов показывает, что в образце 1 в диапазоне 1.5—50 К проводимость осуществляется в основном собственными электронами. Оценка концентрации акцепторов из тех же данных для этого образца дает $N_A < 2 \cdot 10^{15}$ см $^{-3}$.

Образец 2 является также достаточно чистым, хотя имеет слегка большее значение концентрации электронов и примерно в 2 раза меньшее значение подвижности. По оценкам такого же рода для этого образца $N_A < 5 \cdot 10^{15}$ см $^{-3}$.

На рис. 1, 2 представлены зависимости $|\alpha_{xx}(H)|$ при различных температурах для образцов 1, 2. Видно, что при $T < 15$ К кривые $|\alpha_{xx}(H)|$ имеют максимум в области $H_{\max} = (10 \div 20)$ кЭ, при этом значения $|\alpha_{xx}|$ достигают величин $\sim 10^3 \div 10^4$ мкВ/К. При $T \geq 20$ К термоэдс $|\alpha_{xx}|$ монотонно растет с ростом магнитного поля. Величина α_{zz} для этих образцов при $T \geq 15$ К слабо зависит от H и T и равна ~ -80 мкВ/К.

На рис. 3 представлены температурные зависимости α_{xx} в фиксированных магнитных полях для образца 1, а также для сравнения приведены данные по термоэдс α_{xx} для n -InSb в поле 30 кЭ [3]. Видно, что для HgTe при $H > 20$ кЭ зависимости $|\alpha_{xx}(T)|$ имеют максимум при $T \simeq 15$ К. Для этой области полей при $T \geq 20$ К $\alpha_{xx}(T) \sim T^m$, где $m \simeq -4.5$ (рис. 4).

Большие значения поперечной термоэдс ($\sim 10^3 \div 10^4$ мкВ/К), характерная температурная зависимость $\alpha_{xx} \sim T^{-4.5}$, а также малость α_{zz} по сравнению с α_{xx} свидетельствуют о том, что в чистых образцах HgTe мы наблюдаем эффект увлечения электронов фононами в квантующих магнитных полях. Предположение о том, что большие значения $\alpha_{xx}(H)$ в квантующем поле обусловлены эффектом увлечения, было сделано в [4]. Однако из-за отсутствия измерений при $T > 14$ К в этой работе механизм рассеяния фононов в HgTe остался невыясненным.

Для невырожденного электронного газа в квантовом пределе при рассеянии длинноволновых фононов на продольных тепловых фононах (механизм Херинга) поперечная термоэдс увлечения имеет вид [5, 6]

$$\alpha_{xx} = \frac{k/e}{(2\pi)^{3/2} a} \left[\ln \left(\frac{1}{\gamma} \right) - 0.57 \right] \frac{\hbar\omega_n}{kT} \left(\frac{m_n s^2}{kT} \right)^{3/2} \left(\frac{E_0}{kT} \right)^2, \quad (1)$$

где $a \approx 1$, $\gamma = \frac{1}{8} \frac{m_n s^2}{kT} \frac{\hbar\omega_n}{kT}$, m_n — эффективная масса электронов, s — скорость звука, $\omega_n = eH/m_n c$, E_0 — константа деформационного потенциала. Продольная компонента термоэдс увлечения α_{zz} при рассеянии фононов на фононах, по Херингу, в квантовом пределе не зависит от H [3], и величину α_{zz} можно считать оценкой диффузионной части термоэдс.

Условие достижения квантового предела, когда ниже уровня Ферми остается лишь один уровень Ландау, для электронов в HgTe имеет вид (см., например, [7]): $\epsilon_F = \epsilon_b(0) - \epsilon_a(0)$, т. е.

$$\epsilon_F = (3\gamma - \chi) \hbar\omega_0. \quad (2)$$

Здесь $\epsilon_a(0)$, $\epsilon_b(0)$ — уровни Ландау серий a и b с квантовым числом $n=0$;

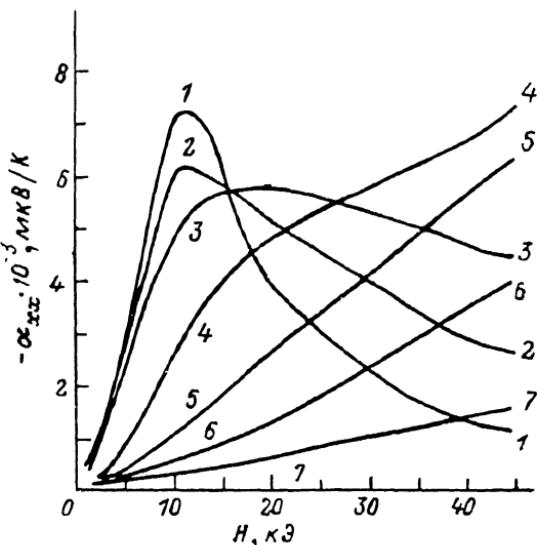


Рис. 1. Зависимость поперечной термоэдс от магнитного поля для образца 1. T, K : 1 — 5, 2 — 8, 3 — 10, 4 — 15, 5 — 20, 6 — 24, 7 — 28.

γ и χ — параметры Латтингджа; ω_0 — циклотронная частота свободного электрона. С дальнейшим ростом H уровень Ферми приближается к дну зоны проводимости и в некотором поле H_c выходит в открываемую магнитным полем щель $\delta(H)$, где

$$\delta(H) = (\gamma_1 - \gamma) \hbar\omega_0, \quad (3)$$

γ_1 — еще один параметр Латтингджа.

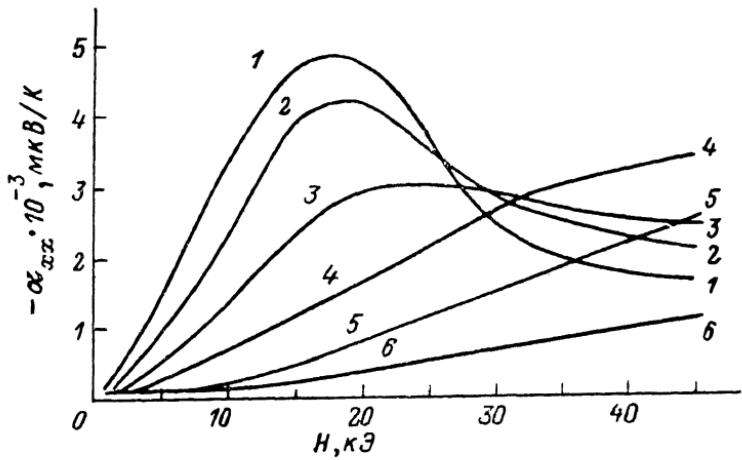


Рис. 2. Зависимость поперечной термоэдс от магнитного поля для образца 2. T, K : 1 — 8, 2 — 10, 3 — 15, 4 — 20, 5 — 25, 6 — 30.

Используя значения параметров Латтингджа из [8], находим, что для образца 1 квантовый предел достигается при 4.2 К в полях $H > 5$ кЭ, при 20 К в полях $H > 20$ кЭ, при 30 К в полях $H > 25$ кЭ. Из решения уравнения ней-

тральнойности для собственного полупроводника в магнитном поле (см. [7]) следует, что в образце 1 выход уровня Ферми из зоны проводимости должен происходить при 4.2 К в поле $H_c = 20$ кЭ, при 20 К в поле $H_c = 45$ кЭ, при 30 К в поле $H_c = 72$ кЭ.

Согласно [9], рассеяние фононов, по Херрингу, является существенным, если частота длинноволнового фона

$$\omega > \omega_2, \quad (4)$$

где $\omega_2 = 10 \frac{kT}{\hbar} \left(\frac{kT}{Ms^2} \right)^{1/2} \left(\frac{T}{\Theta} \right)^{1/2}$, M — масса элементарной ячейки, Θ — температура Дебая. В квантовом пределе характерная частота фона, принимающего участие в увлечении электронов, имеет порядок величины $\omega = sq_H$, где $q_H = (eH/\hbar c)^{1/2}$. Тогда для HgTe ($M = 5.48 \cdot 10^{-22}$ г, $\Theta = 143$ К [10]) в поле 45 кЭ при 20 К $\omega/\omega_2 = 3$, при 30 К $\omega/\omega_2 = 1.3$.

Таким образом, для исследованного образца 1 в поле $H = 45$ кЭ при $T \approx 20$ К условия применимости выражения (1) (квантовый предел, невырожденность

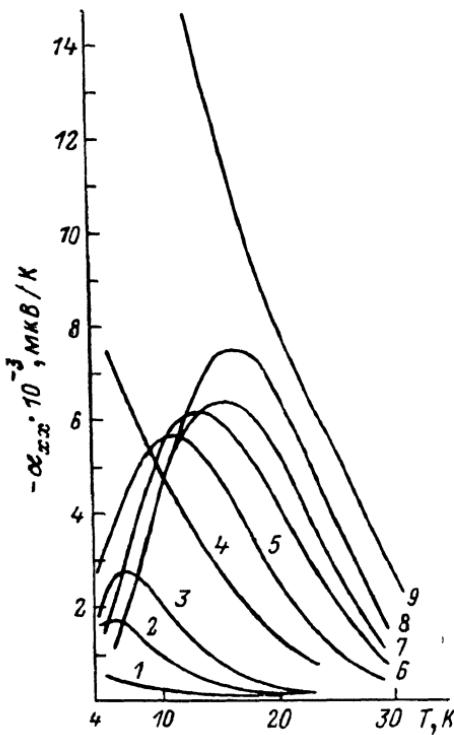


Рис. 3. Зависимость поперечной термоэдс от температуры для образца 1.

H , кЭ: 1 — 1, 2 — 3, 3 — 5, 4 — 10, 5 — 20, 6 — 30, 7 — 40, 8 — 45. 9 — зависимость $\alpha_{xx}(T)$ для образца n -InSb при 30 кЭ [4].

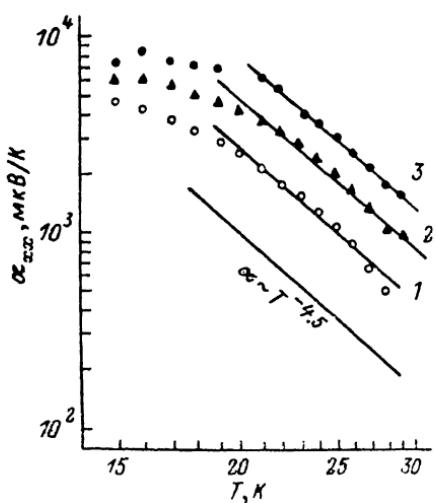


Рис. 4. Зависимость поперечной термоэдс от температуры для образца 1 при $T > 15$ К и $H > 20$ кЭ.

H , кЭ: 1 — 20, 2 — 30, 3 — 45.

электронного газа, механизм рассеяния Херринга) можно считать выполненным, хотя второе условие выполнено лишь «на пределе» ($\epsilon_F \approx 0$). Зависимость $\alpha_{xx}(H)$ при 20 К соответствует (1): в интервале 10–45 кЭ $\alpha_{xx} \sim H$. Сопоставляя экспериментальное значение α_{xx} с выражением (1), можно оценить эффективную константу деформационного потенциала. При $H = 45$ кЭ и $T = 20$ К получаем $E_0 = -1.9$ эВ. Используя численные расчеты интегралов, входящих в выражения для α_{xx} (см. [6]), находим, что ошибка в расчетном значении α_{xx} от применения формулы (1) при $\epsilon_F = 0$ составляет $\sim 20\%$ (для значения $E_0 \sim 10\%$).

При $T = 28$ К в поле 45 кЭ $\epsilon_F = 1.8$ мэВ, т. е. $\epsilon_F \approx kT$, и вырождение электронного газа промежуточное. Для оценки E_0 в этом случае мы используем формулы для α_{xx} как для невырожденного (1), так и для сильно вырожденного ($\epsilon_F \gg kT$) газа электронов [6]. В первом случае находим $E_0 = 2.2$ эВ (оценка сверху), во втором — $E_0 = 0.96$ эВ (оценка снизу). Таким образом, из сопоставления экспериментальных данных для α_{xx} с теоретическими выражениями для термоэдс увлечения в квантовом пределе получаем оценку константы деформационного потенциала в HgTe: $E_0 = (1 \div 2)$ эВ.

Оценку величины E_0 можно провести также из других экспериментов. Эффективная константа E_0 для зоны Γ_8 , входящая в выражение для термодес увлечения, связана с константами a , b и d Бира и Пикуса следующим образом [11]:

$$E_0^2 = \frac{2+\beta}{6\beta} \left[a^2 + \beta \left(b^2 + \frac{1}{2} d^2 \right) \right], \quad (5)$$

где $\beta = c_e/c_t$, а $c_e = \frac{1}{5}(3c_{11} + 2c_{12} + 4c_{44})$, $c_t = \frac{1}{5}(c_{11} - c_{12} + 3c_{44})$ — сферически усредненные упругие коэффициенты. Используя значения констант a , b и d из [12] и значения c_{11} , c_{12} , c_{44} для HgTe из [10], находим $E_0 = 2.4$ эВ в хорошем согласии с нашей оценкой.

Определение величины E_0 из значений подвижности μ_s в HgTe невозможно, так как, по оценкам [12], подвижность электронов в чистых образцах при $T > 20$ К определяется рассеянием на оптических фононах, а роль акустических фононов несущественна.

Рассмотрим поведение α_{xx} при низких температурах $T < 10-15$ К. Из рис. 3 видно, что при $T \geq 15$ К зависимости $\alpha_{xx}(T)$ в InSb и HgTe аналогичны. Однако для более низких температур в InSb продолжается рост $|\alpha_{xx}(T)|$ при понижении T , в то время как в HgTe для достаточно больших полей $H \geq 20$ кЭ величина $|\alpha_{xx}(T)|$ при понижении T падает. Различие в поведении $\alpha_{xx}(T)$ связано с тем, что исследованный образец InSb является образцом n -типа, а образец 1 HgTe — образцом с собственной проводимостью. В полях $H \geq 20$ кЭ между зоной проводимости и валентной зоной HgTe имеется щель $\delta(H)$. При понижении температуры происходит вымораживание как электронов, так и дырок и проводимость начинает определяться каким-либо шунтирующим каналом (поверхностью, примесной проводимостью и т. п.). Резкое уменьшение концентрации электронов из-за вымораживания и приводит к падению $|\alpha_{xx}(T)|$ при понижении T .

Более детально поведение $\alpha_{xx}(T, H)$ можно понять, используя выражение

$$\alpha_{xx}(T, H) = \alpha_1(T, H) \left[1 - \frac{\sigma_2}{\sigma_1(T, H)} - (\mu_2 H)^2 \frac{n_2}{n_1(T, H)} \right], \quad (6)$$

справедливое вблизи максимума величины $|\alpha_{xx}|$ как функции T или H (см. Приложение). В (6) индекс 1 относится к электронной проводимости, а индекс 2 — к остаточному (шунтирующему) механизму проводимости. Как видно из (6), достаточно быстрое убывание $n_1(T)$ (а следовательно, и $\sigma_1(T)$) при понижении температуры должно привести к падению полной величины $|\alpha_{xx}(T)|$, что мы и наблюдаем на опыте. При этом, как и должно быть, для больших полей (больших $\delta(H)$) падение $\alpha_{xx}(T)$ начинается при больших температурах (рис. 3).

В InSb при $T \leq 15$ К основным механизмом рассеяния длинноволновых фононов становится рассеяние их на границах образца [4]. Можно полагать, что это справедливо и для исследованных нами образцов HgTe, и рост $\alpha_{xx}(H)$ при $H < 10$ кЭ для $T \leq 15$ К (рис. 1, 2) обусловлен эффектом увлечения при рассеянии фононов на границах образца. Оценки, однако, показывают, что при $H = 5-10$ кЭ наблюдаемые значения α_{xx} примерно в 3 раза меньше, а зависимость $\alpha_{xx}(H)$ значительно слабее ($\alpha_{xx} \sim H^{1.25}$), чем дает теория для квантового предела ($\alpha_{xx} \sim H^2$). Это, по-видимому, связано с тем, что в полях $H < H_{\max}$ условие квантового предела выполняется плохо. Так, по оценкам, для образца 1 при 10 К квантовый предел должен достигаться лишь в полях $H \geq 8$ кЭ.

Наблюдать термоэдс электронов в собственном HgTe при $T < 10-15$ К и $H \geq 10$ кЭ не удается, так как с ростом H происходит быстрое уменьшение электронного вклада в термоэдс как из-за вымораживания электронов (уменьшение $n_1(H)$ и $\sigma_1(H)$ в (6)), так и из-за их лоренцевского закручивания (рост $\sim H^2$ третьего члена в квадратных скобках в (6)). По мере убывания H электронного вклада термоэдс стремится к своему предельному значению α_2 , обусловленному посторонними механизмами проводимости. Хотя количественные оценки при $T < 10-15$ К затруднены, несомненно, что немонотонная зависимость $\alpha_{xx}(H)$ связана с эффектом увлечения в квантующих магнитных полях (рост $|\alpha_{xx}(H)|$ при $H < H_{\max}$) и процессами вымораживания и лоренцевского закручивания электронов (падение $|\alpha_{xx}(H)|$ при $H > H_{\max}$).

Таким образом, в чистых образцах теллурида ртути с $N_A \leq 5 \cdot 10^{15}$ см⁻³ при $T \leq 30$ К удается наблюдать термоэдс увлечения электронов фононами в квантующих магнитных полях. Наибольшие значения $|\alpha_{xx}| = 7.5 \cdot 10^3$ мкВ/К достигаются в наиболее чистом образце. Можно утверждать, что при $T > 20$ К и $H > 20$ кЭ рассеяние фононов определяется механизмом Херринга, и сопоставление экспериментальных данных с теорией позволяет оценить константу деформационного потенциала HgTe: $E_0 = 1 \div 2$ эВ. Наблюдение эффекта увлечения свидетельствует о том, что исследованные кристаллы HgTe действительно являются чистыми и совершенными.

Приложение

При наличии двух типов носителей тока приближенное выражение для поперечной термоэдс в магнитном поле имеет вид

$$\alpha_{xx} = \frac{(\alpha_1 \sigma_1 + \alpha_2 \sigma_2) (\sigma_1 + \sigma_2) + e^2 \mu_1^2 \mu_2^2 H^2 (n_1 + n_2) (\alpha_1 n_1 + \alpha_2 n_2)}{(\sigma_1 + \sigma_2)^2 + e^2 \mu_1^2 H^2 (n_1 + n_2)^2 \mu_2^2}, \quad (\text{П. 1})$$

где α_i , σ_i , n_i и μ_i — соответственно термоэдс, проводимость, концентрация и подвижность i -го типа носителей. Выражение (П. 1) получено при использовании приближения $\tau (\epsilon) = \text{const}$ для безразмерного параметра $\omega\tau$, входящего в точное выражение для α_{xx} . Формула (П. 1) записана для двух типов носителей одного знака: $e_1 = e_2 = e$.

Пусть при $H=0$ величины проводимости и термоэдс полностью определяются первым типом носителей ($\sigma = \sigma_1$, $\alpha_{xx} = \alpha_1$). С ростом магнитного поля концентрация n_1 и проводимость σ_1 резко убывают (эффект вымораживания), и при не зависящих или слабо зависящих от H величинах α_2 и σ_2 роль второго типа носителей возрастает. В той области полей, где параметры α_2/α_1 , n_2/n_1 и σ_2/σ_1 еще достаточно малы (при этом малость σ_2/σ_1 есть следствие малости n_2/n_1 , так как обычно $\mu_1 \gg \mu_2$), влияние второго сорта носителей можно учесть, разлагая (П. 1) по этим параметрам. Оставляя лишь основные поправочные члены, из (П. 1) получаем выражение (6).

Список литературы

- [1] Galazka R. R. // Phys. Lett. 1970. V. 32A. N 2. P. 101—102. Сологуб В. В., Иванов-Омский В. И., Мужданба В. М., Шалыт С. С. // ФТТ. 1971. Т. 13. В. 6. С. 1738—1740.
- [2] Szlenk K. // Phys. St. Sol. (b). 1979. V. 95. N 2. P. 445—452.
- [3] Puri S. M., Geballe T. H. // Semicond. a. Semimet. 1966. V. 1. P. 203—264.
- [4] Городилов Н. А., Доманская Л. И., Нейфельд Э. А. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 8. С. 1382—1387.
- [5] Гуревич Л. Э., Недлин Г. М. // ФТТ. 1961. Т. 3. В. 9. С. 2779—2790.
- [6] Халфин В. Б. // ФТП. 1968. Т. 2. В. 3. С. 306—313.
- [7] Tsidilkovski I. M., Narus G. I., Shelushinina N. G. // Adv. Phys. 1985. V. 34. N 1. P. 43—174.
- [8] Uchida S., Yoshizaki R., Tanaka S. // Proc. Int. Conf. Phys. Semimet. Narrow Gap Semicond. Nice, 1973. P. 81—83.
- [9] Гуревич Л. Э., Шкловский Б. И. // ФТТ. 1967. Т. 9. В. 2. С. 526—534.
- [10] Берченко Н. Н., Кревс В. Е., Средин В. Г. // Полупроводниковые твердые растворы и их применение. М., 1982. С. 208.
- [11] Wiley J. D. // Semicond. a. Semimet. 1975. V. 10. P. 91—174.
- [12] Dubowski J. J., Dietl T., Szymanska W., Galazka R. R. // J. Phys. Chem. Sol. 1981. V. 42. N 5. P. 351—362.